(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-348240 (P2001-348240A)

(43)公開日 平成13年12月18日(2001.12.18)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 3 B 20/00		C 0 3 B 20/00	H 4G014
C30B 15/10		C30B 15/10	4G077

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)

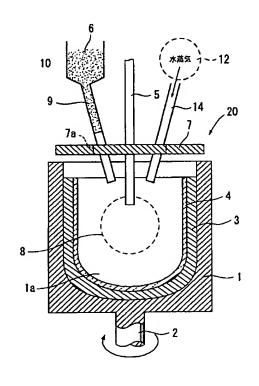
(21)出顧番号	特顧2000-163644(P2000-163644)	(71)出願人 000190138
(21)田殿田写	4719(2000 — 103044(F2000 — 103044)	信越石英株式会社
(22)出顧日	平成12年5月31日(2000.5.31)	東京都新宿区西新宿1丁目22番2号
(OD) MARIA	1,74.2 2,7.5.2 (0.5.5.5.5.5.5)	(72)発明者 大浜 康生
		福井県武生市北府2丁目13番60号 信越石
		英株式会社武生工場内
		(72)発明者 水野 繁夫
		福井県武生市北府2丁目13番60号 信越石
		英株式会社武生工場内
		(74)代理人 100080230
		弁理士 石原 韶二
		Fターム(参考) 4CD14 AHO2 AHO8
		40077 AA02 BA04 CF10 EG02 HA12
		PD01

(54) [発明の名称] 石英ガラスルツボの製造方法

(57)【要約】

【課題】シリコン単結晶引上げの際に融液表面の振動の発生、並びに石英ガラス片の剥離による転位の発生が無く、歩留りの高いシリコン単結晶の引上げが可能な石英ガラスルツボの製造方法を提供する。

【解決手段】回転するモールド内に二酸化珪素粉を供給して、遠心力により成型しルツボ形状の成型体とした後、該成型体を加熱溶融して半透明石英ガラス製ルツボ基体を形成する基体形成工程と、及び該ルツボ基体の形成中もしくは形成後に、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に新たに二酸化珪素粉を供給し、該ルツボ基体内面側に透明石英ガラス製内層を形成する内層形成工程、からなる石英ガラスルツボの製造方法において、該内層形成工程の少なくとも一部の期間に、水蒸気を該ルツボ基体内に導入するようにした。



BEST AVAILABLE COPY

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転するモールド内に二酸化珪素粉を供 給して、遠心力により成型しルツボ形状の成型体とした 後、該成型体を加熱溶融して半透明石英ガラス製ルツボ 基体を形成する基体形成工程と、及び該ルツボ基体の形 成中もしくは形成後に、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内 に新たに二酸化珪素粉を供給し、該ルツボ基体内面側に 透明石英ガラス製内層を形成する内層形成工程、からな る石英ガラスルツボの製造方法において、該内層形成工 程の少なくとも一部の期間に、水蒸気を該ルツボ基体内 10 に導入することを特徴とする石英ガラスルツボの製造方 法。

【請求項2】 回転可能でかつ上方に開口する開口部を 備えたモールドを有する石英ガラスルツボ製造装置を用 い、回転する該モールド内に二酸化珪素粉を供給して、 遠心力により成型しルツボ形状の成型体とした後、該開 □部から電極を挿入しアーク火炎により該成型体を加熱 溶融して半透明石英ガラス製ルツボ基体を形成する基体 形成工程と、及び該ルツボ基体の形成中もしくは形成後 に、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に該開口部より新た 20 に二酸化珪素粉を供給し、該ルツボ基体内面側に透明石 英ガラス製内層を形成する内層形成工程、からなる石英 ガラスルツボの製造方法において、該内層形成工程の少 なくとも一部の期間に、該開口部より該ルツボ基体内に 水蒸気を導入するととを特徴とする石英ガラスルツボの 製造方法。

【請求項3】 回転可能でかつ上方に開口する開口部を 備えたモールドと、該開口部の上方を覆う蓋体とを有す る石英ガラスルツボ製造装置を用い、該蓋体に開穿され た貫通孔を通じて電極を挿入しアーク火炎により前記成 30 型体を加熱溶融し、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に該 貫通孔より新たに二酸化珪素粉を供給し、さらに該貫通 孔を通じて該ルツボ基体内に水蒸気を導入することを特 徴とする請求項1又は2記載の石英ガラスルツボの製造 方法。

【請求項4】 前記水蒸気を導入する期間が前記内層形 成工程の二酸化珪素粉の供給開始から終了までの期間の 少なくとも一部の期間であることを特徴とする請求項1 ~3のいずれか1項記載の製造方法。

【請求項5】 前記水蒸気を導入する期間が前記内層形 40 成工程の期間の少なくとも25%になることを特徴とす る請求項1~4のいずれか1項記載の製造方法。

【請求項6】 前記内層形成工程において形成された前 記透明石英ガラス製内層の内表面の深さ方向 1. 0 mmま での平均〇H濃度が、該内層形成工程で供給された二酸 化珪素粉のOH濃度+80ppm~+350ppmとなるよう に水蒸気の導入量を調節することを特徴とする請求項1 ~5のいずれか1項記載の製造方法。

【請求項7】 前記水蒸気の供給量が前記内層形成工程 で供給する二酸化珪素粉の重量100に対して0.5~ 50 は、溶融加熱エリアの絶対湿度の調整、或いは二酸化珪

100であることを特徴とする請求項1~6のいずれか 1項記載の製造方法。

【請求項8】 前記内層形成工程で導入する水蒸気の単 位時間の供給量が液体換算で2~100ml/minである ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項記載の製 造方法。

【請求項9】 前記内層形成工程で供給される二酸化珪 素粉は、非晶質の石英原料粉であることを特徴とする請 求項1~8のいずれか1項記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコン単結晶の 引上げに好適に使用される石英ガラスルツボの製造方法 に関する。

[0002]

【関連技術】一般に石英ガラスルツボの製造方法は、回 転するモールド内に二酸化珪素粉を供給して、遠心力に よりルツボ形状の成型体に成型した後、アーク火炎によ り該成型体を加熱溶融して半透明石英ガラス製ルツボ基 体(外層)を形成する基体形成工程と、及び該ルツボ基 体の形成中もしくは形成後に、該ルツボ基体内の加熱雰 囲気内に新たに二酸化珪素粉を供給し、ルツボ基体内面 側に透明石英ガラス製内層を形成する内層形成工程と、 から構成されるものである。

【0003】一方、シリコン単結晶の製造には、いわゆ るチョクラルスキー法(CZ法)と呼ばれる方法が広く 採用されている。このCZ法は原料であるシリコン多結 晶を石英ガラスルツボ中で溶融し、この融液にシリコン 単結晶の種結晶を接合し、石英ガラスルツボと種結晶を 回転させながら種結晶を引上げることで、円柱状のシリ コン単結晶を育成する方法である。

【0004】とのCZ法において、シリコン多結晶を溶 融した後、引上げ工程中に発生する重要な問題のひとつ に、融液表面に発生する振動による弊害があると考えら れている。融液表面に振動が発生すると、種結晶をシリ コン融液に接合する作業いわゆる「種付け」作業を困難 にしてしまう、引上げ工程の初期に結晶を乱してしま う、等の問題が生じる。

【0005】との問題を解決する為、本出願人は石英ガ ラスルツボの内表面の表面張力を50mN/m以下とする ことを提案した(特開平2000-72594号公 報)。具体的には、石英ガラスルツボ内表面のOH濃 度、表面粗さ、金属不純物を調節することで、シリコン 融液と石英ガラスルツボとの濡れ性を向上させ、融液表 面の振動を抑制しようとするものであるが、このうち、 表面粗さ、金属不純物は石英ガラスルツボ内面の劣化を 促進するという欠点を持つ為、調節する因子としては〇 H濃度を選択するのが最も好ましいと考えられる。

【0006】上記公報によるとこのOH濃度の調節に

素粉自体のOH濃度の調節が提案されているが、前者は 設備コストが高く且つ所望の〇H濃度への調整が困難で あり、後者は使用する原料粉が制限されるという欠点が あった。

【0007】また、CZ法の引上げ工程中に発生する他 の重要な問題としては石英ガラスルツボ内面からの石英 片の剥離が挙げられる。石英ガラスルツボは、一般的 に、泡を含まず透明な内層と泡を含み不透明な外層の二 重構造となるように作られているが、一見泡が無いよう に見える透明層にも、減圧、髙温下で引上げ工程が進む 10 につれて泡が発生、膨張し、石英ガラスルツボ内表面の 剥離を引き起こすことがある。この剥離した石英ガラス 片が引上げ中の単結晶に付着すると、その部分から転位 が発生し、歩留りを著しく低下させる、等の問題が生じ てしまう。

【0008】との問題を解決する為、本出願人は、シリ コン単結晶引上げ後の石英ガラスルツボ内面 1 mm以内の 泡膨張を抑制することを提案した(特開2000-44 386号公報)。具体的には、石英ガラスルツボの溶融 の際の加熱条件の変更、或いは石英ガラスルツボ透明層 20 に使用する二酸化珪素粉の選択が記載されているが、前 者は許容範囲が広い為、確実に泡膨張を抑制することは 難しく、後者は使用する原料粉が制限されるという欠点 があった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】こうした現状に鑑み、 本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、石英ガラスルツボ の製造方法の内層形成工程においてルツボ基体内に水蒸 気を導入するという簡便な方法で、使用する二酸化珪素 粉に係わらず、容易に石英ガラスルツボ内面の〇H濃度 30 を調節し、且つ内表面近傍の泡膨張を抑制できることを 見出し本発明を完成した。

【0010】すなわち、本発明は、シリコン単結晶引上 げの際に、シリコン融液表面の振動の発生、並びに石英 ガラス片の剥離による転位の発生が無く、歩留りの高い シリコン単結晶の引上げが可能な石英ガラスルツボの製 造方法を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため は、回転するモールド内に二酸化珪素粉を供給して、遠 心力により成型しルツボ形状の成型体とした後、該成型 体を加熱溶融して半透明石英ガラス製ルツボ基体を形成 する基体形成工程と、及び該ルツボ基体の形成中もしく は形成後に、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に新たに二 酸化珪素粉を供給し、該ルツボ基体内面側に透明石英ガ ラス製内層を形成する内層形成工程と、からなる石英ガ ラスルツボの製造方法において、該内層形成工程の少な くとも一部の期間に、水蒸気を該ルツボ基体内に導入す ることを特徴とする。

【0012】本発明の石英ガラスルツボの製造方法の第 2の態様は、回転可能でかつ上方に開口する開口部を備 えたモールドを有する石英ガラスルツボ製造装置を用 い、回転する該モールド内に二酸化珪素粉を供給して、 遠心力により成型しルツボ形状の成型体とした後、該開 口部から電極を挿入しアーク火炎により該成型体を加熱 溶融して半透明石英ガラス製ルツボ基体を形成する基体 形成工程と、及び該ルツボ基体の形成中もしくは形成後 に、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に該開口部より新た に二酸化珪素粉を供給し、該ルツボ基体内面側に透明石 英ガラス製内層を形成する内層形成工程、からなる石英 ガラスルツボの製造方法において、該内層形成工程の少 なくとも一部の期間に、該開口部より該ルツボ基体内に 水蒸気を導入することを特徴とする。

【0013】回転可能でかつ上方に開口する開口部を備 えたモールドと、該開口部の上方を覆う蓋体とを有する 石英ガラスルツボ製造装置を用い、該蓋体に開穿された 貫通孔を通じて電極を挿入しアーク火炎により前記成型 体を加熱溶融し、該ルツボ基体内の加熱雰囲気内に該貫 通孔より新たに二酸化珪素粉を供給し、さらに該貫通孔 を通じて該ルツボ基体内に水蒸気を導入する構成とする こともできる。

【0014】上記水蒸気を導入する期間は該内層形成工 程の期間の少なくとも25%、好ましくは40%以上と することが望ましい。また、水蒸気を導入する期間とし ては上記内層形成工程の二酸化珪素粉の供給開始から終 了までの期間の少なくとも一部の期間が好適である。水 蒸気の導入は上記基体形成工程において行うことも可能 であるが、との場合はルツボ全体のOH濃度が上昇する 為、水蒸気導入量を誤ると製造した石英ガラスルツボの 粘度の大幅な低下を引き起とし、形状の崩れにつながる 為、注意が必要である。

【0015】上記水蒸気の導入量は上記内層形成工程に おいて形成された上記透明石英ガラス製内層の内表面の 深さ方向1.0mmまでの平均〇H濃度が、内層形成工程 で供給された二酸化珪素粉のOH濃度+80ppm~+3 50ppm、好ましくは+100ppm~+250ppmとなる ように調節するのが望ましい。

【0016】上記内層形成工程において、該ルツボ基体 に、本発明の石英ガラスルツボの製造方法の第1の態様 40 内に導入する水蒸気の導入量は、内層形成工程で供給す る二酸化珪素粉の重量100に対して0.5~100の 範囲とすれば良い。但し要求される水蒸気量はルツボの 大きさにより異なる為、ルツボ外径が40㎝~63.4 cmの範囲においては、二酸化珪素粉の重量100に対し て0.5~40、好ましくは1~30、ルツボ外径が6 3.5cm~73.9cmの範囲においては1~60、好ま しくは1.5~50、ルツボ外径が74cm~125cmま での範囲においては1.25~100、好ましくは2~ 80とするのが望ましい。

50 【0017】水蒸気の単位時間の導入量は液体換算で2

~ $100\,\mathrm{ml/min}$ の範囲とすればよい。但しての値もルッボの大きさに左右され、ルッボ外径が $40\sim63$. $4\,\mathrm{cm}$ では $2\sim40\,\mathrm{ml/min}$ 、好ましくは $4\sim30\,\mathrm{ml/min}$ 、63. $5\sim73$. $9\,\mathrm{cm}$ では $4\sim60\,\mathrm{ml/min}$ 、好ましくは $6\sim50\,\mathrm{ml/min}$ 、 $7\,4\sim125\,\mathrm{cm}$ では $5\sim100\,\mathrm{ml}$ /min、好ましくは $8\sim80\,\mathrm{ml/min}$ とするのが望ましい。

【0018】本発明における二酸化珪素粉は、非晶質及び結晶質ならびに天然及び合成を包含し、非晶質の二酸化珪素粉を「石英ガラス粉」、結晶質の二酸化珪素粉を 10「石英粉」と称するものとする。すなわち、例えば外層の原料粉には天然石英粉を用いるのが実用的であるが、天然石英ガラス粉、合成石英粉、及び各種粉体を混合したものを用いてもよく、また、内層の原料粉には合成石英ガラス粉を用いるのが実用的であるが、合成石英粉、天然石英ガラス粉、及び各種粉体を混合したものを用いてもよい。

[0019]

【発明の実施の形態】以下に本発明の一つの実施の形態を添付図面中、図1に基づいて説明する。図1は本発明 20 方法の実施に使用される石英ガラスルツボ製造装置と該装置を使用する石英ガラスルツボの製造方法を示す概略断面説明図である。なお、図示例は例示的に示されるもので、本発明の技術思想から逸脱しない限り種々の変形が可能なととはいうまでもない。

【0020】図1に示す石英ガラスルツボ製造装置20 程には回転可能でかつ上方に開口する開口部を備えたモール ラスド1を有している。該モールド1の開口部は、その上方 が蓋体7で覆われる。該蓋体7の中央部には貫通孔7 a が開穿されている。該在ールド1は回転軸2を具え、該 30 る。モールド1内にはキャビティ1 a が形成されている。符号3 は半透明石英ガラス製のルツボ基体で、石英ガラス 使用ルツボの外層部を構成する。該ルツボ基体3は二酸化珪 素粉、例えば天然石英粉を回転するモールド1のキャビ ティ1 a 内で遠心力により所望のルツボ形状の成型体に 成型し、この成型体を内面からカーボン電極5のアーク 以炎により加熱して該二酸化珪素粉を溶融させることに よって形成される(基体形成工程)。 発明

【0021】該ルツボ基体3の形成中もしくは形成後に、該モールド1を回転させながらカーボン電極5のア 40 ーク火炎により加熱を行い、該ルツボ基体3内に高温ガス雰囲気8を形成させるとともに、新たに二酸化珪素粉6をホッパー10からノズル9を介して少量ずつ該高温ガス雰囲気8内に供給する。二酸化珪素粉6は、該高温ガス雰囲気8内の熱により少なくとも一部が溶融され、同時に該ルツボ基体3の内壁面に向けて飛散させられて、該ルツボ基体3の内壁面に付着し、該ルツボ基体3と一体的で実質的に無気泡な透明石英ガラス製内層4を形成する(内層形成工程)。これらの半透明石英ガラス製ルツボ基体3 透明石英ガラス製内層4の形成方法に 50

ついては特公平4-22861号公報に詳細な記載がある

【0022】本発明方法の眼目は、上記した内層形成工程の少なくとも一部の期間、好ましくは二酸化珪素粉6の供給開始から終了までの期間の少なくとも一部の期間に、水蒸気12を、導入手段14を通じて、ルツボ基体3内に導入することとである。このルツボ基体3内に導入された水蒸気は二酸化珪素紛の溶融部分へさらに誘導されることとなる。

【0023】との水蒸気12の種類、導入方法は問わないが、使用する水は不純物の少ない純水、更には超純水を使用することが望ましく、例えばこれらの水をヒータ等の熱源で加熱することで蒸発させ、蒸気圧の利用または送風機等の使用により、例えば石英ガラス製導入管等の導入手段14を通じて、ルツボ基体3内へと導入すればよい。また、該導入には高圧スプレー、その他の噴霧手段を用いてもよく、この場合、加圧または超音波発振等によって噴霧された水微粒子が、ルツボ基体3内への導入時に水蒸気となっていればよい。

10 【0024】電極を挿入する貫通孔7aを有する板状蓋体7を使用する場合、水蒸気12の導入は、該貫通孔7aより行う。との場合の水蒸気の導入位置は内層形成工程で供給する二酸化珪素粉6の供給位置に近い方が望ましく、150mm以内が好適である。

【0025】なお、水蒸気12の導入は上記基体形成工程において行うことも可能であるが、この場合は石英ガラスルツボ全体のOH濃度が上昇する為、水蒸気導入量を誤ると製造した石英ガラスルツボ粘度の大幅な低下を引き起こし、形状の崩れにつながる為、注意が必要である

・【0026】本発明において石英ガラスルツボの原料に使用される二酸化珪素粉としては、天然石英粉、合成石英粉、大然石英ガラス粉、合成石英ガラス粉等の各種粉体を適宜選択することが可能である。例えば、天然の水晶や珪砂・珪石等を粉砕し純化して得られる天然石英粉は、コスト上の利点とともに作成された石英ガラスルツボ自体が耐熱性に優れるというメリットがあるため、本発明の石英ガラスルツボの外層の原料として好適である。

【0027】また、より高純度の粉体として合成石英ガラス粉がルツボ内層の原料として好適であり、具体的には、シリコンアルコキシド、ハロゲン化珪素(四塩化珪素ほか)、珪酸ソーダその他の珪素化合物を出発材料として、ゾルゲル法、スート法、火炎燃焼法等で得られる合成石英ガラス粉を適宜選択することができ、それ以外にもフュームドシリカや沈降シリカ等も利用できる。

て、該ルツボ基体3の内壁面に付着し、該ルツボ基体3 と一体的で実質的に無気泡な透明石英ガラス製内層4を 形成する(内層形成工程)。とれらの半透明石英ガラス 製ルツボ基体3、透明石英ガラス製内層4の形成方法に 50 ガラス粉、合成石英粉、又は前記各種粉体を混合したも の、ならびに結晶化促進や不純物遮蔽等に寄与する元素 を含有するもの (アルミニウム化合物その他) 及びそれ らを混合したもの、等を内外層の原料として用いること ができる。

[0029]

【実施例】以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的 に説明するが、これらの実施例は例示的に示されるもの で限定的に解釈されるべきでないことはいうまでもな 41

述したと同様の方法により、粒径100~300 µmの 天然石英粉を回転するモールド内に供給し、厚さ30mm の粉体層からなる成型体を成型し、アーク放電により該 成型体の内部から加熱溶融すると同時に、その高温雰囲 気中に、OH濃度5ppmの合成石英ガラス粉を100g/ minで40min、計4000g供給し、との合成石英ガラ ス粉の供給開始とともに水蒸気を20ml/minで30mi n、計600ml導入し、内側全体にわたり厚さ1~3mm の透明石英ガラス製内層を有する、直径22インチの石 英ガラスルツボを作成した。

【0031】との作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1.0mmまでの平均OH濃度を測定したところ、 200ppmであった。

【0032】との石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 引上げを減圧下で行ったところ、シリコン融液表面の振 動は発生せず、スムーズに種付けを行うことができ、引 上げ中に転位等が発生することもなく完全なシリコン単 結晶が引き上がった。使用後の石英ガラスルツボの内層 (透明層)を透明層を観察したところ、いずれも内表面 近傍に泡膨張は観測されなかった。当該使用後の石英ガ 30 ラスルツボの湾曲部 (r部)を厚さ1.0mmにカットし た断面の顕微鏡写真を図3に示す。また、比較のため使 用前の石英ガラスルツボの湾曲部の同様の顕微鏡写真を 図2として示した。

【0033】(実施例2)実施例1と同様の方法によ り、粒径100~300 µmの天然石英粉を回転するモ ールド内に供給し、厚さ30mmの粉体層からなる成型体 を成型し、アーク放電により該成型体の内部から加熱溶 融すると同時に、その高温雰囲気中に、OH濃度5ppm の合成石英ガラス粉を100g/minで40min、計40 00g供給し、この合成石英ガラス粉の供給開始ととも に水蒸気を5m1/minで16min、計80m1導入し、内側 全体にわたり厚さ1~3mmの透明石英ガラス製内層を有 する、直径22インチの石英ガラスルツボを作成した。 【0034】この作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1. Ommまでの平均OH濃度を測定したところ、 120ppmであった。

【0035】との石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 引上げを減圧下で行ったところ、シリコン融液表面の振 上げ中に転位等が発生することもなく完全なシリコン単 結晶が引き上がった。使用後の石英ガラスルツボの内層 (透明層)を観察したところ、いずれも内表面近傍に泡 膨張は観測されなかった。

【0036】(実施例3)実施例1と同様の方法によ り、粒径100~300μmの天然石英粉を回転するモ ールド内に供給し、厚さ30mmの粉体層からなる成型体 を成型し、アーク放電により該成型体の内部から加熱溶 融すると同時に、その髙温雰囲気中に、OH浪度5ppm 【0030】(実施例1)図1に示した装置を用い、前 10 の合成石英ガラス粉を100g/minで40min、計40 00g供給し、との合成石英ガラス粉の供給開始ととも に水蒸気を30m1/minで40min、計1200ml導入 し、内側全体にわたり厚さ1~3mmの透明石英ガラス製 内層を有する、直径22インチの石英ガラスルツボを作 成した。

> 【0037】との作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1.0mmまでの平均OH濃度を測定したところ、 250ppmであった。

【0038】との石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 20 引上げを減圧下で行ったところ、シリコン融液表面の振 動は発生せず、スムーズに種付けを行うことができ、引 上げ中に転位等が発生することもなく完全なシリコン単 結晶が引上がった。使用後の石英ガラスルツボ内面の内 層(透明層)を観察したところ、いずれも内表面近傍に 泡膨張は観測されなかった。

【0039】(実施例4)実施例1と同様の方法によ り、粒径100~300µmの天然石英粉を回転するモ ールド内に供給し、厚さ30mmの粉体層からなる成型体 を成型し、アーク放電により該成型体の内部から加熱溶 融すると同時に、その高温雰囲気中に、OH濃度100 ppmの非晶質合成石英粉を100g/minで40min、計4 000a供給し、この合成石英粉の供給開始とともに水 蒸気を20ml/minで30min、計600ml導入し、内側 全体にわたり厚さ1~3mmの透明石英ガラス製内層を有 する、直径22インチの石英ガラスルツボを作成した。 【0040】との作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1.0mmまでの平均OH濃度を測定したところ、 290ppmであった。

【0041】この石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 40 引上げを滅圧下で行ったところ、シリコン融液表面の振 動は発生せず、スムーズに種付けを行うことができ、引 上げ中に転位等が発生することもなく完全なシリコン単 結晶が引き上がった。使用後の石英ガラスルツボの内層 (透明層)を観察したところ、いずれも内表面近傍に泡 膨張は観測されなかった。

【0042】(実施例5)実施例1と同様の方法によ り、粒径100~300μmの天然石英粉を回転するモ ールド内に供給し、厚さ40mmの粉体層からなる成型体 を成型し、アーク放電により該成型体の内部から加熱溶 動は発生せず、スムーズに種付けを行うととができ、引 50 融すると同時に、その髙温雰囲気中に、〇H濃度 5 ppm

の合成石英ガラス粉を100g/minで100min、計1 0000g供給し、この合成石英ガラス粉の供給開始と ともに水蒸気を50ml/minで100min、計5000ml 導入し、内側全体にわたり厚さ 1~3 mmの透明石英ガラ ス製内層を有する、直径30インチの石英ガラスルツボ を作成した。

【0043】との作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1.0mmまでの平均OH浪度を測定したところ、 220 ppmであった。

【0044】との石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 10 引上げを減圧下で行ったところ、シリコン融液表面の振 動は発生せず、スムーズに種付けを行うことができ、引 上げ中に転位等が発生することもなく完全なシリコン単 結晶が引き上がった。使用後の石英ガラスルツボの内層 (透明層)を観察したところ、いずれも内表面近傍に泡 膨張は観測されなかった。

【0045】(比較例1)実施例1と同様の方法によ り、粒径100~300 µmの天然石英粉を回転するモ ールド内に供給し、厚さ30mmの粉体層からなる成型体 を成型し、アーク放電により該成型体の内部から加熱溶 20 【図2】 実施例1によって製造された石英ガラスルツ 融すると同時に、その髙温雰囲気中に、OH濃度5ppm の合成石英ガラス粉を100g/minで40min、計40 00 q供給し、内側全体にわたり厚さ1~3 mmの透明石 英ガラス製内層を有する、直径22インチの石英ガラス ルツボを作成した。

【0046】との作成した石英ガラスルツボの内表面深 さ方向1.0mmまでの平均OH濃度を測定したところ、 75 ppmであった。

【0047】との石英ガラスルツボでシリコン単結晶の 引上げを減圧下で行ったととろ、シリコン融液表面の振 30 【符号の説明】 動が発生し、1度でスムーズに種付けを行うことができ ず、何度か種付け作業を試みる必要が生じた。さらに、 種付け後は引上げ中に湯面振動がおさまるのを確認でき たが、引上げ工程の後半でシリコン単結晶に転位が発生 したため、所定の工程を完了できずに途中で引上げを終 えた。使用後の石英ガラスルツボの内層(透明層)を観

察したところ、内表面近傍に、有転位の原因と見られる 著しい気泡膨張が認められた。使用後の当該石英ガラス ルツボの湾曲部(r部)を厚さ1.0mmにカットした断 面の顕微鏡写真を図5に示す。また、比較のため使用前 の当該石英ガラスルルツボの湾曲部の同様の顕微鏡写真 を図4として示した。

[0048]

【発明の効果】以上述べたととく、本発明のシリコン単 結晶引上げ用石英ガラスルツボの製造方法によれば、内 層形成工程においてツルボ基体内に水蒸気を導入すると いう簡便な方法で、シリコン単結晶を引上げの際に、シ リコン融液面の振動の発生並びに石英ガラス片の剥離に よる転位の発生が無く、単結晶引上げの歩留りが著しく 向上した石英ガラスルツボを得ることができるという著 大な効果が達成される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明方法の実施に使用される装置と該装置 を使用する石英ガラスルツボの製造方法を示す概略断面 説明図である。

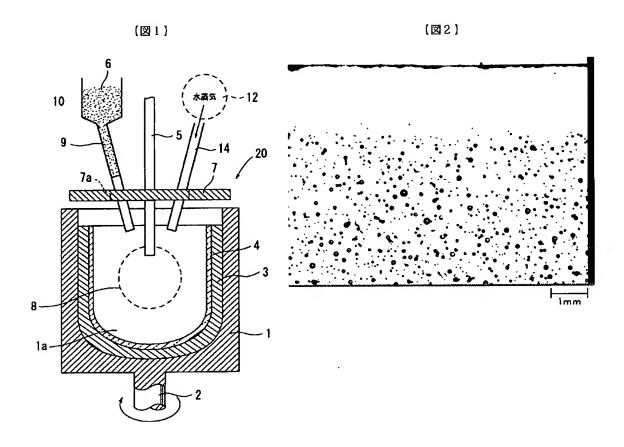
ボの湾曲部の断面を示す顕微鏡写真である。

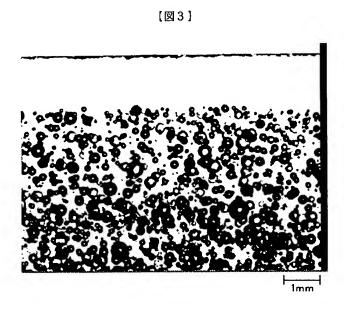
【図3】 実施例1によって製造された石英ガラスルツ ボを用いてシリコン単結晶を引上げた後の石英ガラスル ツボの湾曲部の断面を示す顕微鏡写真である。

【図4】 比較例1によって製造された石英ガラスルツ ボの湾曲部の断面を示す顕微鏡写真である。

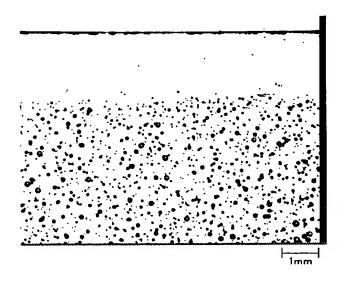
【図5】 比較例1によって製造された石英ガラスルツ ボを用いてシリコン単結晶を引き上げた後の石英ガラス ルツボの湾曲部の断面を示す顕微鏡写真である。

1:モールド、1a:キャビティ、2:回転軸、3:半 透明石英ガラス製のルツボ基体、4:透明石英ガラス内 層、5:カーボン電極、6:二酸化珪素粉、7:蓋体、 7a:貫通孔、8:髙温ガス雰囲気、9:ノズル、1 0:ホッパー、12:水蒸気、14:導入手段、20: 石英ガラスルツボ製造装置。

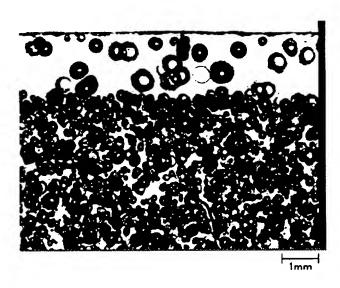




【図4】



【図5】



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLA	ACK BORDERS	
IMA	AGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FAI	DED TEXT OR DRAWING	•
BLU	JRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	-
SKI	EWED/SLANTED IMAGES	
□ coi	LORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	·
☐ GRA	AY SCALE DOCUMENTS	
· LIN	ES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
□ REP	ERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	Y
□ OTF	IER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox